

机械剥离氧化硅硅基底二硫化钨

中文名称： 机械剥离氧化硅硅基底二硫化钨

英文名称： Mechanical exfoliation WS₂ on SiO₂/Si

货 号： ML1110

CAS 号： 7440-33-7

包 装： 1 片

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 薄膜

参 数

基 底： 二氧化硅/硅

氧化层： 300nm

基底尺寸： 10 mmx10 mm

WS2 面积： $>10 \mu\text{m}^2$

应用： 酶联生物最新推出机械剥离制备的二硫化钨，该类材料具有缺陷少，优异的光学性质，可以研究层数和荧光效应，此外，由于保持了原有晶格结构，所以该类材料是制备器件的理想材料。